

各 位

集束イオンビームフォトマスク修正装置「Draco」を開発、販売を開始

株式会社ブイ・テクノロジー(神奈川県横浜市神戸町 134 横浜ビジネスパーク 9F、代表取締役 兼 社長執行役員:杉本 重人)は、半導体および高精細 OLED ディスプレイや大型ディスプレイ用フォトマスクに対応した、新しい欠陥修正装置「Draco(ドラコ)」の開発に成功、この度、販売を開始しました。

<背景等>

5G等の情報通信技術の高度化、脱炭素そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の普及等を背景に、半導体やフラットパネルディスプレイ(以下、FPD)技術の進化が加速しています。また、これらトレンドを受け、用途毎に最適化された半導体や高精細で大画面な FPD の開発が進んでいます。このような電子デバイス製造を根幹で支えるフォトマスクについては、世界的に需要が高まると共に、これまで以上に高い品質と信頼性が求められています。

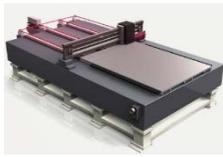
当社は、測定・欠陥検査・欠陥修正の点からフォトマスク製造工程の品質をトータルで支える製品をラインナップしております。お客様のご期待に更に高いレベルでお応えし、ハイエンドフォトマスクの品質を更に高める集束イオンビームフォトマスク修正装置 (FIB フォトマスク修正装置) を開発、この度、Draco シリーズとして販売を開始しました。

<装置の特長と主な仕様>

Draco シリーズは、9インチサイズまでの半導体用フォトマスクおよび1.8×2.0mサイズまでのディスプレイ用フォトマスクに対応しています。最小修正可能線幅 300nm、修正精度±25nmでの描画が可能です。また、局所真空技術を採用し40%の省スペース化を実現しております。さらに、フォトマスクを大気圧中で取り扱うため、基板のローディング・アンローディング時間を大幅に短縮しています。

<フォトマスク用装置ラインナップ>

半導体および中小型の高精細な OLED から大型 LCD まで多様かつ高いレベルの品質が求められるフォトマスクの製造を、検査・修正・測定のトータルで支える製品ラインナップをご提供しています。

検査装置	修正装置		精密座標測定装置
Gemini シリーズ	Draco シリーズ(New)	Sculptor シリーズ	MercurySHR シリーズ
			
透過・落射光学系による同時検査により、高精細 OLED から LCD 用の多様なフォトマスクの検査に応えます。	FIB と高剛性ステージにより、白欠陥・黒欠陥の修正に加え、様々なパターンを高い位置精度で描画可能です。	ガスウィンドウ方式レーザー-CVD により様々な欠陥の修正が可能です。	最先端のセラミック技術を用いた高剛性ステージと独自の測定ソフトウェアによる世界最高レベルの位置寸法管理環境を実現しています。

今後は、お客様毎に異なるご要請にきめ細かくお応えする提案を重ね、半導体・ディスプレイ製造装置のリーディングカンパニーとして、大なる志と溢れる情熱で、世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献する所存です。引続き皆様からのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<お問合せ先>

株式会社ブイ・テクノロジー 管理本部 社長室
〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 1 3 4 横浜ビジネスパークイーストタワー 9F
TEL : 045-338-1980
Web : <https://www.vtec.co.jp/ja/contact.html>